

ЛИТЕРАТУРА

1. Величко, О. И. Система уравнений радиационно-стимулированной диффузии ионно-имплантированных примесей: мат. VII всесоюзной конференции “Взаимодействие атомных частиц с твердым телом” / О. И. Величко. Минск: Изд. МРТИ. 1984. Ч. 2. С. 180.
2. Uskov, V. A. Effect of nonuniform vacancy distribution on diffusion of impurities in semiconductors / V. A. Uskov, V. V. Vas'kin // Inorganic Materials. 1972. Vol. 8. No. 10. P. 1617.
3. Morikawa, Ya. Uphill diffusion mechanism in proton-irradiated silicon / Ya. Morikawa, K. Yamamoto, K. Nagami // Appl. Phys. Lett. 1980. Vol. 36. No. 12. P. 997.
4. Strack, H. Ion bombardment of silicon in a glow discharge / H. Strack // J. Appl. Phys. 1963. Vol. 34. No. 8. P. 2405.

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРИСТАЛЛОВ TlGaS₂

В. Г. Гуртовой, А. У. Шелег, С. Н. Мустафаева, Э. М. Керимова

ГО «НПЦ НАН Беларусь по материаловедению», iftpanb@physics.by

Кристаллы TlGaS₂ являются представителями большой группы тройных таллиевых халькогенидных соединений типа TlA^{III}B^{VI}₂ (A = In, Ga; B = S, Se, Te). Эти кристаллы имеют ярко выраженную слоистую структуру и представляют собой квазидвумерные системы с интересными физическими свойствами. Слоистая структура, как правило, приводит к проявлению анизотропии ряда физических характеристик и образованию политипных модификаций таких кристаллов, что значительно сказывается на их физических свойствах [1].

Большинство кристаллов этой группы проявляют как полупроводниковые, так и сегнетоэлектрические свойства. У некоторых представителей этого семейства при изменении температуры обнаружены последовательности фазовых переходов (ФП). Обусловленные наличием в них длиннопериодических соизмеримых и несоизмеримых сверхструктур и их преобразованием с изменением температуры [2]. Рентгенографические исследования кристаллов TlGaS₂ [3] показали наличие скачка параметра элементарной ячейки при $T = 127$ К. Следует отметить, что в одной из последних работ [4], в которой приводятся результаты исследования теплоёмкости, в кристалле TlGaS₂ зафиксированы ФП при $T_1 = 177$ К и $T_2 = 241$ К.

Следует отметить, что в литературе имеются значительные расхождения результатов по исследованию свойств кристаллов этого семейства. Такие расхождения могут иметь несколько причин. Во-первых, модулированная сверхструктура очень чувствительна к состоянию образца (структурные дефекты, различные примеси и т.д.), что сказывается на температурах ФП в кристалле. Во-вторых, так как эти кристаллы склонны к политипии, их физические свойства могут различаться. Кроме того, в этих кристаллах может образоваться смесь политипов. Поэтому представляло значительный интерес установить, как влияют примеси определённого сорта на физические характеристики этих кристаллов.

Известно, что легирование соединений приводит к изменению их физических свойств. В [5] показано, что частичное замещение галлия марганцем в монокристаллах TlGaS₂ приводит к увеличению коэффициента рентгеночувствительности. Частичное замещение галлия кобальтом в монокристаллах TlGaS₂, как показано в [6],

приводит к увеличению электросопротивления и сдвигу края поглощения в область низких энергий.

Целью данной работы было установление закономерностей изменения электропроводности и диэлектрической проницаемости кристаллов $TlGaS_2$, легированных переходными элементами, в зависимости от температуры и природы легирующего химического элемента.

Измерения диэлектрической проницаемости (ϵ) и электропроводности (σ) проводили методом плоского конденсатора на монокристаллических пластинках толщиной $\sim 0.7 - 1.5$ мм вдоль кристаллографического направления [001] с помощью цифрового измерителя Е7-20 на частотах измерительного поля $10^3 - 10^6$ Гц в температурном диапазоне 140 - 300 К.

На рисунках 1 и 2 приведены температурные зависимости удельной диэлектрической проницаемости монокристаллов $TlGaS_2$ и $TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S_2$ и $TlGa_{0.995}Cr_{0.005}S_2$ вдоль кристаллографического направления [001] на частотах $10^3 - 10^6$ Гц.

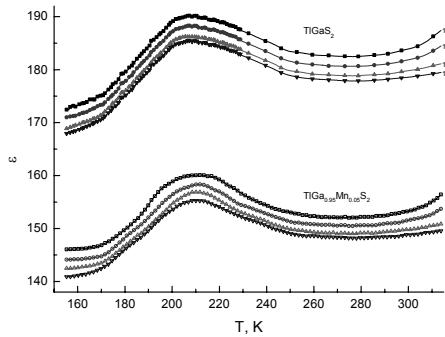


Рис. 1. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости монокристаллов $TlGaS_2$ и $TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S_2$

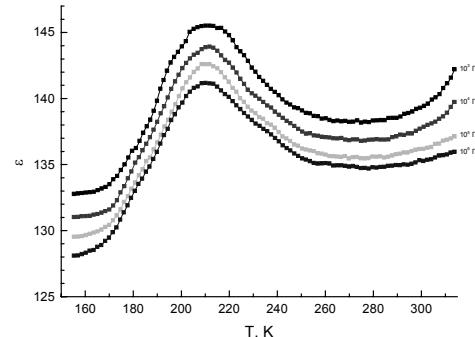


Рис. 2. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости монокристаллов $TlGa_{0.995}Cr_{0.005}S_2$

Как видно из рисунков, значения ϵ с ростом температуры увеличиваются. Наблюдается значительная дисперсия диэлектрической проницаемости. С ростом частоты значения ϵ уменьшаются, что обусловлено, как известно, релаксационными процессами, происходящими в высокочастотной области измерений.

На кривых $\epsilon = f(T)$ в области температур $\sim 170 - 240$ К наблюдается широкий максимум. Ранее при исследовании теплоемкости [4] и оптических свойств [5, 6] кристаллов $TlGaS_2$ было установлено, что в области температур ~ 173 К и ~ 238 К наблюдаются аномалии соответствующих физических свойств. Возможно, в области температур $170 - 240$ К в кристалле $TlGaS_2$, как чистом, так и легированном марганцем, существует несоизмеримая фаза, и поэтому наблюдается такой характер температурной зависимости ϵ . Однако, для такого утверждения необходимы детальные исследования особенностей кристаллической структуры этого кристалла в этой области температур.

Как видно из рисунка 1, легирование кристаллов $TlGaS_2$ марганцем (5 ат. %) приводит к некоторому уменьшению значений диэлектрической проницаемости ($\sim 15\%$), при этом не оказывая заметного влияния на характер температурных зависимостей и фазовых переходов соразмерная–несоразмерная фаза.

На рисунке 3 приведены температурные зависимости удельной электропроводности монокристаллов $TlGaS_2$, $TlGa_{0.995}Cr_{0.005}S_2$ и $TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S_2$ вдоль кристаллограф-

фического направления [001] на частотах 10^3 - 10^6 Гц. Видно, что значения σ с ростом температуры увеличиваются. Это обусловлено увеличением концентрации свободных носителей зарядов (проявление полупроводниковых свойств) и ростом подвижности доменных границ (проявление сегнетоэлектрических свойств) в результате повышения температуры. Видно, что наблюдается значительная дисперсия проводимости. С ростом частоты проводимость растет, что обусловлено, как известно, релаксационными процессами, происходящими в высокочастотной области измерений. На кривых $\sigma = f(T)$ для исследованных кристаллов в области $T \sim 170$ К наблюдается излом, который возможно обусловлен ФП соразмерная–несоразмерная фаза при этой температуре. На кривых температурной зависимости электропроводности в области высоких температур можно выделить два участка, которые отличаются наклонами и различным механизмом электропроводности.

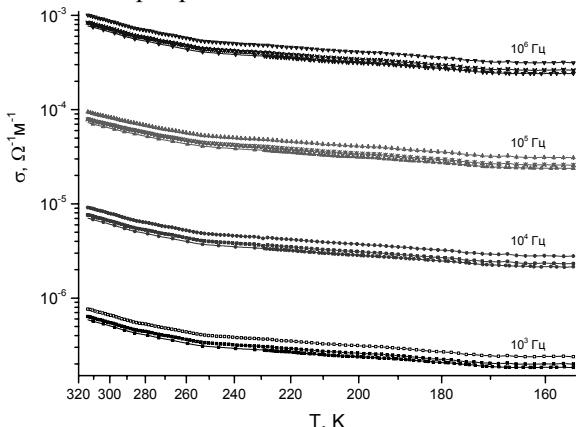


Рис. 3. Температурные зависимости удельной электропроводности монокристаллов
(1) – TlGaS₂, (2) – TlGa_{0.995}Cr_{0.005}S₂ и (3) – TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S₂

Как видно из рисунка, легирование кристаллов TlGaS₂ хромом (0.5 ат. %) и марганцем (5 ат. %) приводит к некоторому увеличению электропроводности (~11% для TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S₂), при этом не оказывая заметного влияния на характер температурных зависимостей и ФП соразмерная–несоразмерная фаза.

Таким образом, впервые проведены исследования удельной диэлектрической проницаемости и электропроводности температур монокристаллов TlGaS₂, TlGa_{0.995}Cr_{0.005}S₂ и TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S₂ в широком интервале. Подтверждено наличие фазовых переходов второго рода соразмерная – несоразмерная фаза в области температур ~ 173 К. Показано, что легирование кристаллов TlGaS₂ хромом (0.5 ат. %) и марганцем (5 ат. %) приводит к некоторому уменьшению значений диэлектрической проницаемости (~15% для TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S₂) и увеличению электропроводности (~11% для TlGa_{0.95}Mn_{0.05}S₂), при этом не оказывая заметного влияния на характер температурных зависимостей и фазовых переходов соразмерная–несоразмерная фаза.

ЛИТЕРАТУРА

- Боровой, Н.А. Влияние политипии на структурные фазовые превращения в кристаллах TlGaSe₂ / Н.А. Боровой [и др.] // Физика твердого тела. 2009. Т. 51. №11. С. 2229.

2. McMorrow, D.F. The structure of the paraelectric and incommensurate phases of TlGaSe₂ / D.F. McMorrow [и др.] // Journal of Physics: Condensed Matter. 1990. V. 2. N 16. P. 3699.
3. Мальсагов, А.У. Рентгенографическое исследование соединений TlInS₂, TlGaS₂ и твердых растворов Tl_{0.98}Cu_{0.02}InS₂, Tl_{0.98}Ag_{0.02}GaS₂ при 93–293 К / А.У. Мальсагов, Б.С. Кульбужиев, Б.М. Хамхоев // Неорганические материалы. 1989. Т. 25. №2. С. 216.
4. Açıkgöz, M. Heat Capacity Anomalies of TlInS₂ and TlGaS₂ Single Crystals Detected by Differential Scanning Calorimetry (DSC) / M. Açıkgöz // Turkish Journal of Physics. 2008. P. 32. P. 145.
5. Мустафаева, С.Н. Фотоэлектрические и рентгенодозиметрические свойства монокристаллов TlGa_{0.97}Mn_{0.03}S₂ / С.Н. Мустафаева // Неорганические материалы. 2009. Т. 45. №6. С. 659.
6. Karabulut, O. Electrical and optical properties of Co doped TlGaS₂ crystals / O. Karabulut, K. Yilmaz, B. Boz // Crystal Research and Technology. 2011. V. 46. N 1. P. 79.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕФЕКТОВ В МОНОКРИСТАЛЛАХ СИНТЕТИЧЕСКОГО АЛМАЗА ПРИ ОБЛУЧЕНИИ УСКОРЕННЫМИ ЭЛЕКТРОНАМИ И ОТЖИГЕ

Г. А. Гусаков¹, А. В. Мудрый²

¹НИИ прикладных физических проблем им. А.Н.Севченко БГУ, gga68@rambler.ru

²Научно-практический центр НАН Беларусь по материаловедению

Последнее десятилетие радиационным дефектам в алмазе уделяется повышенное внимание. Прежде всего, это относится к центру (N-V)⁻, который в настоящее время рассматривается как базовый элемент будущего квантового процессора, необходимого для создания квантового компьютера, линий связи с квантовым протоколом безопасности и других применений спинtronики [1].

В экспериментах использовались монокристаллы синтетического алмаза, выращенные методом температурного градиента [2] в системе металла-катализатора Ni-Fe-C. Содержание фоновых примесей в исследованных образцах варьировалось в диапазоне $(1\dots 3)\times 10^{19}$ атомов/см³. Облучение электронами с энергией 6 МэВ производилось на линейном ускорителе УЭЛВ-10-10. Интенсивность облучения составляла $\sim 5\times 10^{12}$ эл·см⁻²·с⁻¹. Доза облучения варьировалась в интервале от 2×10^{17} до $1,5\times 10^{18}$ эл·см⁻². Образцы крепились в специальном охлаждаемом держателе. Разогрев образцов не превышал 150°C. Термообработка облученных кристаллов производилась в вакууме в температурном интервале от 300 до 1700°C. Дефектно-примесный состав кристаллов алмаза контролировался при помощи методов поглощения света в диапазоне длин волн 0,2–25 мкм и фотолюминесценции.

Исходные кристаллы алмаза относились к типу Ib, т.е. содержали примесь азота преимущественно в форме одиночных атомов в положении замещения (С-дефекты). Типичный спектр поглощения в видимой области исходного кристалла синтетического алмаза приведены на рисунке 1 (спектр 1). Облучение синтетических алмазов ускоренными электронами приводит к возникновению в спектрах поглощения света широкой полосы 620 нм с бесфонной линией 741 нм, интенсивность которой увеличивается с ростом дозы облучения. Данная полоса соответствует центру GR1 (вакансия в нейтральном состоянии). Наблюдается также и некоторый сдвиг «вторичного» края поглощения в красную область. Сдвиг «вторичного» края поглощения в красную область, по-видимому, вызван образованием центров ND1 (вакансия в отрицательно заряженном состоянии).